

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

9315239

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 2149824 A2 19900608 <No. of Patents: 008>

THIN FILM TRANSISTOR (English)

Patent Assignee: NIPPON ELECTRIC CO

Author (Inventor): KANEKO SETSUO

IPC: *G02F-001/136; H01L-029/40; H01L-029/784

JAPIO Reference No: 140398P000022

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
DE 68921567	C0	19950413	DE 68921567	A	19891129
DE 68921567	T2	19950706	DE 68921567	A	19891129
EP 372821	A2	19900613	EP 89312448	A	19891129
EP 372821	A3	19910508	EP 89312448	A	19891129
EP 372821	B1	19950308	EP 89312448	A	19891129
JP 2149824	A2	19900608	JP 88304383	A	19881130 (BASIC)
JP 2157827	A2	19900618	JP 88313341	A	19881212
US 5166816	A	19921124	US 695260	A	19910531

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 88304383 A 19881130

JP 88313341 A 19881212

US 442773 B1 19891129

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03182327 **Image available**

THIN FILM TRANSISTOR ARRAY DEVICE

PUB. NO.: 02-157827 [JP 2157827 A]

PUBLISHED: June 18, 1990 (19900618)

INVENTOR(s): SUKEGAWA OSAMU

APPLICANT(s): NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP
(Japan)

APPL. NO.: 63-313341 [JP 88313341]

FILED: December 12, 1988 (19881212)

INTL CLASS: [5] G02F-001/136; H01L-027/12; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2
(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R096 (ELECTRONIC MATERIALS --
Glass

Conductors); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins)

JOURNAL: Section: P, Section No. 1101, Vol. 14, No. 409, Pg. 22,
September 05, 1990 (19900905)

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent the short-circuit between a picture element electrode and a source electrode or a drain electrode, and to increase the manufacturing yield of products by connecting the picture element electrode through an aperture part in an inter-layer insulating film to the source electrode or drain electrode.

CONSTITUTION: In a thin film transistor (TR) array device providing plural thin film TRs arranged to an array, and plural picture element electrodes 10, which are mutually connected, a silicon nitriding film 8 as the inter-layer insulating film is provided on a source electrode 7 and a drain electrode 6 of the thin film TR, and the source electrode 7 is connected through an aperture part 9 to the picture element electrode 10. Since the silicon nitriding film 10 exists between the drain electrode 6 and the picture element electrode 10, even when a photo resist defect exists, the interval between the picture element electrode 10 and the drain electrode 6 does not electrically short-circuited. Thus, the yield of the products can be improved.

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平2-157827

⑤ Int. Cl.³

G 02 F 1/136
H 01 L 27/12
29/784

識別記号

5 0 0

A

庁内整理番号

7370-2H
7514-5F

④ 公開 平成2年(1990)6月18日

8624-5F H 01 L 29/78 3 1 1 S

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑬ 発明の名称 薄膜トランジスタアレイ装置

⑭ 特 願 昭63-313341

⑮ 出 願 昭63(1988)12月12日

⑯ 発 明 者 助 川 統 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑰ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

⑱ 代 理 人 弁理士 井出 直孝

明 細 書

1. 発明の名称

薄膜トランジスタアレイ装置

2. 特許請求の範囲

1. アレイ状に配列された複数の薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタにそれぞれ接続された複数の画素電極とを備えた薄膜トランジスタアレイ装置において、

前記薄膜トランジスタのソース電極およびドレイン電極上に層間絶縁膜を設け、

この層間絶縁膜中に設けられた開口部を介して前記ソース電極またはドレイン電極と前記画素電極とを接続した

ことを特徴とする薄膜トランジスタアレイ装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は液晶ディスプレイ用の薄膜トランジスタ

アレイ装置の製造に利用される。

本発明は画素電極(ピクセル電極)を有する薄膜トランジスタアレイ装置に関し、特に、そのドレイン・ソース電極と画素電極の構成に関する。

(概要)

本発明は、アレイ状に配列された複数の薄膜トランジスタと、各薄膜トランジスタのソース電極またはドレイン電極にそれぞれ接続された画素電極とを備えた薄膜トランジスタアレイ装置において、

前記ソース電極またはドレイン電極と前記画素電極との接続を、前記ソース電極および前記ドレイン電極上に設けられた絶縁膜中の開口部を介して行うようにすることにより、

前記画素電極と前記ソース電極または前記ドレイン電極との短絡を防止し、製品の製造歩留りの向上を図ったものである。

(従来の技術)

従来、液晶ディスプレイ用の薄膜トランジスタアレイ装置においては、トランジスタ部アイラン

ドを形成した後、金属によりドレイン電極およびソース電極を形成し、次に、透明導電膜を成膜し、パターンニングすることによりソース画素電極を形成していた。

第3図はかかる従来の薄膜トランジスタアレイ装置の要部を示す模式的縦断面図である。ドレイン電極6およびソース電極7は、Cr(クロム)を3000Åスパッタにより成膜しパターン化して形成され、しかる後、ITO(In_2O_3 と SnO_2 との混合物、Indium Tin Oxide)をスパッタにより800Å成膜し、パターン化することにより画素電極10が形成される。

なお、第3図において、1はガラス基板、2はゲート電極、3はゲート絶縁膜としてのシリコン窒化膜、4は真性アモルファスシリコン層(以下、 $i-a-Si$ という。)、および5は n^+ 型アモルファスシリコン層(以下、 n^+-a-Si という。)である。

〔発明が解決しようとする問題点〕

前述した従来の薄膜トランジスタアレイ装置に

おいては、ドレイン電極6と画素電極10が接続されたソース電極7が同一面内に形成されるため、PR(ホトレジスト)欠陥により、ドレイン電極一面素電極間の短絡欠陥が発生する欠点がある。特に、ディスプレイ用薄膜トランジスタアレイ装置の場合、画素開口率を大きくするため、ドレインラインと画素電極間の間隔はできる限り狭くすることが望ましいため、この短絡欠陥の発生頻度は、他のパターン形成と比べ格段に高いものとなり、薄膜トランジスタアレイ装置の歩留りを低下させる大きな要因となっている。

本発明の目的は、前記の欠点を除去することにより、画素電極とソース電極またはドレイン電極との短絡欠陥の発生を防止し、製品の歩留りを向上できる薄膜トランジスタアレイ装置を提供することにある。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明は、アレイ状に配列された複数の薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタにそれぞれ接続された複数の画素電極とを備えた薄膜トラン

ジスタアレイ装置において、前記薄膜トランジスタのソース電極およびドレイン電極上に層間絶縁膜を設け、この層間絶縁膜中に設けられた開口部を介して前記ソース電極またはドレイン電極と前記画素電極とを接続したことを特徴とする。

〔作用〕

画素電極とソース電極またはドレイン電極との接続は、層間絶縁膜中の開口部を介して行われる。

従って、画素電極とソース電極またはドレイン電極間には層間絶縁膜(例えば窒化シリコン膜)が介在し、たとえ、PR欠陥が存在しても両電極間が電氣的に短絡することはなくなり、製品の製造歩留りを向上させることが可能となる。

〔実施例〕

以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

第1図は本発明の第一実施例の要部を示す模式的縦断面図で、一つの薄膜トランジスタを取り出して示したものである。

本第一実施例は、アレイ状に配列された複数の

薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタにそれぞれ接続された複数の画素電極10とを備えた薄膜トランジスタアレイ装置において、

前記薄膜トランジスタのソース電極7およびドレイン電極6上に層間絶縁膜としてのシリコン窒化(SiNx)膜8を設け、このシリコン窒化膜8に設けられた開口部9を介してソース電極7と画素電極10とを接続したものである。

なお、第1図において、1はガラス基板、2はゲート電極、3はゲート絶縁膜、4は $i-a-Si$ 層、および5は n^+-a-Si 層である。

本発明の特徴は、第1図において、開口部9を有するシリコン窒化膜8を設けたことにある。

次に、本第一実施例の製造方法について説明する。

ガラス基板1上にゲート電極2が形成され、ゲート絶縁膜として窒化シリコン膜3が3000Å、トランジスタ層として $i-a-Si$ 層4が3000Å、オーミックコンタクト層として n^+-a-Si 層5が500Å、それぞれ形成される。次に、トランジス

タ部以外の $i-a-Si$ 層 4 および n^+-a-Si 層 5 が除去され、ドレイン電極 6 およびソース電極 7 となる Cr が 3000 Å スパッタにより形成されパターン化される。その後、層間絶縁膜として窒化シリコン膜 8 を 1000 Å 形成し、開口部 9 をエッチングにより形成し、ITO 800 Å をスパッタにより形成して、パターンニングし画素電極 10 を形成する。

本第一実施例によれば、ドレイン電極 6 と画素電極 10 の間には窒化シリコン膜 8 が存在し、たとえ PR 欠陥が存在しても、画素電極 10 とドレイン電極 6 が電氣的に短絡することはない。

第 2 図は本発明の第二実施例の要部を示す模式的縦断面図である。

本第二実施例は、層間絶縁膜をポリイミド膜 11 によって形成し、その開口部 9 によって、ソース電極 7 と画素電極 10 とを接続したものである。

本発明の特徴は、第 2 図において開口部 9 を有するポリイミド膜 11 を設けたことにある。

本発明の第二実施例は、窒化シリコン膜 8 の代

わりにポリイミド膜 11 を形成することで、前述の第一実施例と同様にして製造される。

本第二実施例では、薄膜トランジスタアレイ装置の表面が平坦な形状となり、液晶パネル形成におけるギャップ制御、および配向制御が行いやすい利点がある。

なお、前述の説明は、画素電極とソース電極とが接続される場合について行ったけれども、ソース電極の代わりに画素電極とドレイン電極とが接続される場合も同様である。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明は、薄膜トランジスタのドレイン・ソース電極と画素電極の間に層間絶縁膜を設け、この層間絶縁膜中の開口部を介して両者を接続することにより、両者の短絡欠陥を大幅に低減でき、製品の歩留りを向上できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の第一実施例の要部を示す模式的縦断面図。

的縦断面図。

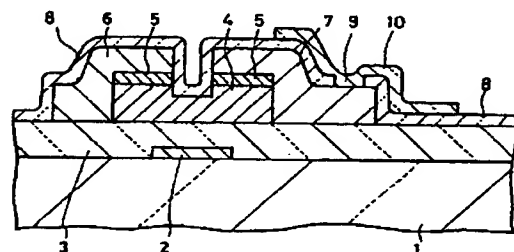
第 2 図は本発明の第二実施例の要部を示す模式的縦断面図。

第 3 図は従来例の要部を示す模式的縦断面図。

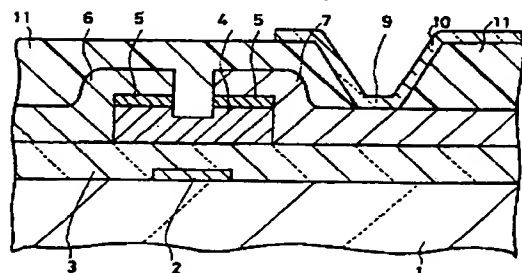
1…ガラス基板、2…ゲート電極、3、8…シリコン窒化膜、4… $i-a-Si$ 層、5… n^+-a-Si 層、6…ドレイン電極、7…ソース電極、9…開口部、10…画素電極、11…ポリイミド膜。

特許出願人 日本電気株式会社
代理人 弁理士 井出直孝

1: ガラス基板 5: n^+-a-Si 層 9: 開口部
2: ゲート電極 6: ドレイン電極 10: 画素電極
3, 8: 窒化シリコン膜 7: ソース電極 11: ポリイミド膜
4: $i-a-Si$ 層

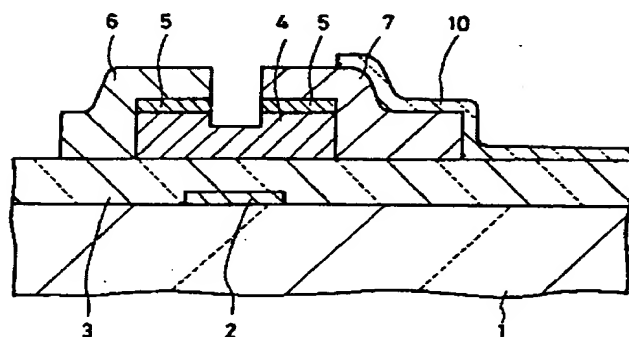


第一実施例
第 1 図



第二実施例
第 2 図

- 1 : ガラス基板 5 : n^+ - α -Si 層
 2 : ゲート電極 6 : ドレイン電極
 3 : 窒化シリコン膜 7 : ソース電極
 4 : i - α -Si 層 10 : 画素電極



従来例
 第 3 図